



Aparatura do nanoszenia cienkich warstw metodą PVD
Thin Film Deposition System (PVD)
Nano 36, Kurt J.Lesker

Laboratorium Syntezy Cienkowarstwowej
Centrum Nanotechnologii A
Thin-layer Synthesis Lab
Nanotechnology Centre A

Osoba odpowiedzialna:
Contact person:
dr hab inż. Grażyna Jarosz,
grajaros@pg.edu.pl +48 58 3471687,
sekretariat, secretariat: +48 58 3482800



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

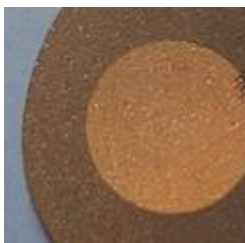
Aparatura

- Klosz ze szkła Pyrex®, 12'' średnica x 18'' wysokość, z zabezpieczeniem przeciw implozji
- Ręcznie sterowany proces nanoszenia warstw, do 3 materiałów w jednym cyklu
- Kontrola grubości poprzez mikrowagę
- Zmiana masek bez zapowietrzania
- Pompa dyfuzyjna zapewniająca wysoką próżnię

Zastosowania

- Wygodny system wytwarzania planarnych struktur organicznych
- Możliwość nanoszenia planarnych i koplanarnych elektrod
- Wytwarzanie organicznych i hybrydowych cienkowarstwowych struktur fotowoltaicznych

Przykładowe cienkie warstwy



Z

złota elektroda na niesiona na próbce



**GDAŃSK UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY**

FACULTY OF APPLIED PHYSICS AND MATHEMATICS

Instruments

- 12'' diameter x 18'' high glass Pyrex® bell jar with implosion guard
- Manual deposition processes up to 3 materials in a single cycle
- Microbalance for thickness control
- Mask-changing under vacuum
- Diffusion pump for high vacuum

Applications

- Convenient deposition system for producing planar organic structures
- Ability to deposit planar or coplanar electrodes
- Preparation of organic and hybrid thin-films photovoltaic structures

Sample coatings

